# C/E表面镀 Al膜的原子氧试验

## 任屏源<sup>1,2</sup> 任 妮<sup>1</sup> 马占吉<sup>1</sup> 肖更竭<sup>1</sup> 武生虎<sup>1</sup>

(1 兰州物理研究所表面工程技术国家级重点实验室,兰州 730000)(2 兰州大学材料系,兰州 730000)

文 摘 为了提高 C/E复合材料的导电性及耐空间环境的能力,应用电弧离子镀技术在 C/E复合材料表面沉积了 AI膜,研究了地面模拟原子氧环境对 C/E复合材料表面镀 AI前后的侵蚀、质损及 AI膜的附着力、导电性的影响。通过 XRD、SEM、FT - R、万能拉伸测试仪、FZ - 82数字式四探针测试仪等测试分析样品。结果表明:电弧离子镀 AI膜微米级以上颗粒较多,但分布均匀,膜层致密,附着力达 2 N/mm<sup>2</sup>以上;原子氧对 C/E 复合材料侵蚀明显,镀铝后具有明显的防护作用;原子氧侵蚀后的 AI膜电阻率有所上升,但还是有较好的导电性;辐照后的 AI膜附着力比辐照前反而增加,其机理尚待进一步研究。

关键词 C/E复合材料, Al膜, 电弧离子镀, 原子氧, 防护

## Effects of Atomic Oxygen on C/E Composite-Based Aluminum Films

Ren Pingyuan<sup>1,2</sup> Ren N i<sup>1</sup> Ma Zhan ji<sup>1</sup> Xiao Gengjie<sup>1</sup> Wu Shenghu<sup>1</sup> (1 National Key Laboratory of Surface Engineering, Lanzhou Institute of Physics, Lanzhou 730000) (2 Department of Materials Science, Lanzhou University, Lanzhou 730000)

Abstract The arc ion plating equipment is applied to deposit Al films on the C/E composite in order to enhance the atom ic oxygen corrosion resistant ability of the C/E composite and to enhance its electric conductivity. C/E composite surface morphology corrosion and mass loss are studied on atom ic oxygen environment ground simulation experiments Meanwhile, the effect of C/E composite-based alum inum films, including surface morphology corrosion, mass loss, film adhesion with substrate and electric conductivity, is studied by the atom ic oxygen ground-based simulation equipment. The samples are tested and analyzed with XRD, SEM, FT - IR, universal material testing machine, the FZ - 82 digital four-probe arrangement and other instruments. The result indicates: The grains of the Al films of arc ion plating are distributed evenly and compactly, though the size of most grains is in micron order, with the adhesion of or ver 2 N/mm<sup>2</sup>. C/E composite is corroded badly by atom ic oxygen exposure, so the protective film is essential. The electric resistivity of Al films is increased with atom ic oxygen exposure, and its mechanism needs further study.

Key words C/E composite, A lum inum film, Arc ion plating, A tom ic oxygen, Protection

## 1 引言

空间环境非常恶劣,在低地球轨道环境<sup>[1~4]</sup>(200 ~700 km)中以原子氧(AO)环境为主。AO是一种 强氧化剂,具有很强的侵蚀作用,在高度约为 250 km 的轨道上 AO密度达 10<sup>°</sup>/cm<sup>3</sup>;当航天器以 8 km/s左 右速度在近地轨道运动时,AO冲击航天器表面的能 量约为 5 eV,这将使其表面剥蚀形成"类地毯 形貌 导致性能退化,而影响航天器寿命<sup>[5~7]</sup>。碳纤维本身 具有导电性,但不如金属好,加上环氧树脂后,使其导 电性能下降而成为不良导体,采用 C/E复合材料制 成的航天器高频天线组件电性能不能满足使用要求。 因此,在 C/E复合材料表面镀金属膜,既能对 AO有 防护作用,又能提高其表面导电性,将有效解决这两 大问题。

宇航材料工艺 2007年 第4期

收稿日期: 2007 - 01 - 15

作者简介:任屏源,1981年出生,硕士,主要从事复合材料的表面改性研究

- 2 试验
- 2.1 原材料

空间专用 C/E样片 30 mm ×50 mm 若干。

2.2 样品制备

采用兰州物理研究所的 VACF大型电弧离子镀 膜设备镀 A1膜,实验步骤如下:

(1)清洗基片,用白绸布沾丙酮擦洗三遍,然后 用乙醇超声波振荡仪清洗 10 min;待样品自然风干后 刷一层聚酰亚胺底胶,放入烘箱固化,先在 40 固化 0.5 h,然后在 65 固化 0.5 h,最后升温至 80 固化 2 h:

(2)将样片固定在真空室镀膜工装上;

(3)抽气,真空室的压力 >1.1 mPa;

(5)镀膜;

(6)设备放气,取出样品。

镀膜时工艺条件如下:

(1)放电弧压为 28~30 V;

(2)脉冲偏压为 130 V, 2 500 Hz,占空比 20%;

(3)气体压力为 11~13 mPa;

(4)基片正对弧源,距离弧源 1 m。

2.3 空间环境 AO试验

AO试验在兰州物理研究所完成。该设备为航 天专用地面模拟空间环境所用,见图 1、图 2。试验所 得到的现象和数据与近地轨道直接暴露试验可以定 性吻合。



## 图 1 AO装置结构示意图

Fig 1 Structure pattern of atom ic oxygen simulation equipment



图 2 AO装置试样架

Fig 2 Sample shelf pattern of structure pattern of atomic oxygen simulation equipment

试验时把样品用切割机分成小于 20 mm ×20 mm 块状,清洗干净后放入试验设备中。开机抽真空并保证真空室压力为 0.2 Pa。该设备通过同轴微波

源放电产生 AO。通入的氧气流量 12 cm<sup>3</sup>/min,试验 的 AO能量为 5~8 eV。试验前后用高精度电子天平 称量样品 (精确到 1 ×10<sup>-5</sup>g),测定材料的质量损失。 宇航材料工艺 2007年 第 4期

试验后采用 XRD、SEM、FT - IR、万能拉伸测试 仪、FZ - 82数字式四探针测试仪等对样品进行测试 分析。

## 3 结果与分析

## 3.1 质损分析

从表 1可以看出,在 AO累计通量 4.1 ×10<sup>20</sup>AO/ m<sup>2</sup>时:C/E复合材料被 AO侵蚀,剥落,质损严重些; 镀 AI膜后 AO的质损侵蚀明显好转,说明 AI膜起到 了一定的保护作用;AI膜存在的质损,可能是由于 AO束流轰击,使 AI膜表面部分脱落;或由于样品表 面本身含有少量水分子,在真空中被抽除均导致微小 质损差别。试验的 AO累计通量相当于在 400 km高 度的近地轨道下,太阳射电辐射下运行两个月<sup>[8]</sup>。

## 表 1 试验前后样品质量变化

Tab. 1 Quality variety of sample before and after

a tom ic oxygen exposure

试样	AO通量密度 /10 <sup>16</sup> cm <sup>2</sup> · s <sup>-1</sup>	作用时间 <sub>/min</sub>	试验前 /mg	试验后 /mg	单位质损 /%
Al膜 /C <sub>f</sub>	1. 57	435	507.37	506.39	0. 19
C/E	1. 57	435	694.36	688.94	0. 787

## 3.2 SEM 分析

用日本电子光学公司生产的 JSM - 5600LV 低真 空扫描电子显微镜分析金属化涂层的表面形貌和断 层形貌,在检测涂层表面形貌之前,被测试样均用超 声波振荡仪清洗;断面先在 300<sup>#</sup>砂纸上磨,然后在 900<sup>#</sup>砂纸上磨,再在绒布上抛光,见图 3。



(a) 薄膜表面试验前



(b) 膜层断面试验前

宇航材料工艺 2007年 第4期



(c) 试验后



(d) 试验后 图 3 A I膜的 SEM 照片 Fig 3 SEM images of aluminum film

从图 3(a)看出:薄膜较均匀致密,同时存在零星大 液滴颗粒,表面颗粒呈球形,一般认为<sup>[9~10]</sup>,离子镀 时,阴极靶熔融的物料(颗粒)从阴极弧斑微熔池喷 射出来形成的液滴在空间呈球状,固化在基材表面时 则变得扁平,呈鹅卵状颗粒。其大小不等,粒度从小 于一微米到十几微米,个别的达几十微米。图 3(b) 为膜层断面,两条直划线间为膜层厚度,两直划线上 方为基底。图 3(b)可以看出膜层不存在明显的通孔 状缺陷,说明膜层致密。从图上看出,A1膜起到一定 的防护作用,A1膜出现小孔。产生孔洞原因如下:一 是样品基底材料粗糙凹凸不平;二是镀膜工艺过程; 三是强烈的 AO束流剥蚀。前两者影响薄膜均匀性 致密性,尤其对于薄膜的薄弱处,在强烈的 AO束流 剥蚀下,薄膜易被剥蚀。

## 3.3 XRD分析

图 4为电弧离子镀 Al膜的 XRD。



— 67 —

从图 4可以看出: AO 辐照前后的 A1膜 XRD衍 射谱一致,说明 AO 辐照后未改变 A1膜的晶体结构。 辐照后 (200)峰宽化,原因可能是结晶度下降。辐照 后 A1膜表面应该出现氧化铝峰,以阻止 AO 的进一 步腐蚀,但由于其含量很少, XRD不能检测出来。

3.4 FT-IR分析

对 AO辐照前后的 C/E复合材料及镀 A1膜进行 分析, FT- ℝ分析谱图见图 5、图 6。



Fig 5 FT -  $\mathbb{R}$  spectrum of C/E composite

图 5表明,3 370 cm<sup>-1</sup>为酰胺 NH峰振动,2 933、 2 930、2 833及 2 871 cm<sup>-1</sup>为 CH峰,1 594 cm<sup>-1</sup>为酰 胺的羰基峰,1 102 cm<sup>-1</sup>为 C—O,1 710 cm<sup>-1</sup>为 C— O,1 592、1 511及 807 cm<sup>-1</sup>为苯环。C/E复合材料经 AO辐照后,峰形变化大。原因如下:一是 AO对材料 表面轰击,打乱了原来官能团,造成一些碎片;二是部 分物质发生了氧化;三是部分物质挥发。从而说明 AO对 C/E材料腐蚀严重,需要防护,否则影响其性 能缩短其使用寿命。

图 6表明: 2 922, 2 910, 2 844及 2 855 cm<sup>-1</sup>对应 于 CH<sub>2</sub> 或 CH<sub>3</sub> 振动,它们通常以 2条或 3条峰出现; 1 608 cm<sup>-1</sup>对应于酰胺基团振动; 1 438及 1 461 cm<sup>-1</sup> 对应于 CH峰变形振动, 1 647及 1 551 cm<sup>-1</sup>对应于 酰胺官能团振动。这些酰胺官能团的出现,应该为基 底物质的反映。说明在薄膜太薄的情况下,尤其样品 表面粗糙不平, AO 辐照使得薄膜薄弱部分出现孔 洞,薄膜变薄,红外线穿透,基底部分官能团出现。整体来看,AO试验前后红外光谱变化不是很大,说明 AI膜起到了一定的防护作用。



Fig 6 FT - IR spectrum of aluminum film

#### 3.5 薄膜附着力测试

薄膜与基体材料表面附着结合的强弱,是评价薄膜质量的一个重要指标,作为航天应用的材料,薄膜 必须与基体材料有良好的附着力,否则薄膜易起皱或 从基体剥落。

薄膜与基体表面结合机制<sup>[11]</sup>十分复杂。附着力 分为基准附着力和实际附着力两种,一般情况下以实 际测得的使薄膜从基体表面剥离单位面积所需的力 或能量,作为附着强度的度量。附着力测试方法有多 种,本试验采用电子万能试验机测试,结果见表 2。

表 2 AI膜附着力

Tab 2 Adhesion force of a lum in um film N/mm<sup>2</sup>

样品编号	AO辐照前 A1膜附着力	AO 辐照后 A I 膜附着力
1#	1. 78	4. 65
2#	2. 26	4. 02
3#	2. 05	5. 22
均值	2.03	4. 63

从表 2可看出辐照前薄膜附着力分布在 1.78~

宇航材料工艺 2007年 第 4期

2 05 N /mm<sup>2</sup>,平均值 > 2 N /mm<sup>2</sup>;辐照后 A I膜附着力 分布在 4 02 ~ 5 22 N /mm<sup>2</sup>,平均值 > 4 N /mm<sup>2</sup>。经 AO辐照后,薄膜附着力反而增大,其机理尚待进一 步研究。

## 3.6 导电性能

## 3.6.1 薄膜导电连续性测试

将万用表设置为通断档,选择镀 A1样品若干以 及 AO试验后的 A1膜,任意两点作为测试点,共测试 40对测试点,均为导通,说明 A1膜导电连续性较好。

## 3.6.2 薄膜电阻率测试

A1块材的电阻率为 2 66 ×10<sup>-8</sup> m。通过四探 针法测试了电弧离子镀的 A1膜,结果见图 7。





图 7表明 AI膜辐照前,电阻率为 (5.27~9.20) ×10<sup>-8</sup> ·m,十分接近 A1块电阻率,说明电弧镀 A1 膜比较致密。辐照后,电阻率为 (14.4~38.4) × 10<sup>-8</sup> ·m,电阻率上升了几倍,这和图 4中 XRD 吻 合,AO试验后 A1膜部分被氧化,形成氧化物,但其含 量极少而 XRD分析不出,同时膜的结晶度下降,从而 导致辐照后薄膜电阻率上升,但此时的导电性仍较 好。 4 结论

(1)电弧离子镀 A1膜,微米级以上颗粒较多,但 分布均匀,膜层致密,与基底的附着力  $> 2 \text{ N}/\text{mm}^2$ 。

(2)AO对 C/E复合材料侵蚀作用明显,镀 A1后 具有明显的防护作用。

(3)AO辐照后,AI膜与 C/E基材的附着力比辐 照前反而增加,其机理尚待进一步研究。

(4) AO 辐照后,电阻率有所上升,但导电性仍较 好。

## 参考文献

1 Trojaola M. Sens Actuators A Phys , 1993; 37 ~ 38: 233 ~ 238

2 Burya A I, Cherkasova N G, Kazakov M E et al Fibre Composite Materials, 2001; (4): 44 ~ 47

3 Iskanderova Z Kleinan J, Gudinenko Y et al Nuclear Instruments and Methods in Phys Research B, 1997; 127/128: 702 ~ 709

4 Haruvy Y. European Space Agency Journal 1990; 14 (1): 109 ~ 119

5 Regnier N, Fontaine S Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2001; 64: 789 ~ 799

6 Deev IS, Nikishin Composites Scinence and Technology, 1997; 57: 1 391 ~ 1 401

7 Babaevsky P G, Kozlov N A, Churib IV et al Cosmic Research, 2005; 43 (1): 27 ~ 35

8 都亨,叶宗海.低轨道航天器空间环境手册.北京:国 防工业出版社,1996

9 M inton T K, Zhang J, Garton D J. Collision-assisted erosion of hydrocarbon polymers in atomic-oxygen environments High Perform Polymers, 2000; 12:  $27 \sim 42$ 

10 Dobrovol skaya I P, Chereiski Z Yu, Perepelkin K E et al Fibre composite Fibre Chemistry, 2003;  $35(4): 17 \sim 21$ 

11 田民波,刘德令编译.薄膜科学与技术 (上册).北京: 机械工业出版社,1991:174~178

(编辑 吴坚)

#### 宇航材料工艺 2007年 第4期